

2026年1月9日（金）

2025年度CGDP第4回講習会

「NIL（Nano Imprint Lithography）の現状と周辺技術」が、2026年1月9日に開催されました。

当日はハイブリッド開催で約60名の会員の皆さんにご参加いただきました。今回はキャノン、芝浦メカトロニクス、CrossPas社 の専門家らが登壇し、NILを半導体デバイス製造に適用する際の各種課題とデバイス製造に不可欠な平坦化技術について紹介が行われました。特に、現地開催のみで実施された総合討論では、講師陣に加え、ゲストとして大日本印刷の専門家も参加し、聴講者を交えた活発な意見交換が行われました。続く交流会においては終始賑やかな雰囲気の中で議論が交わされ、産学交流が一層深まる有意義な機会となりました。



講演の様子

総合討論の様子（現地実施のみ）

会員さまの声

セミコンでのキャノンブースなどで情報を得ていたが、本日のような技術的な話を聞けて非常に興味深かったです。

総合討論の場で、現状をどのように捉えるか、今後をどう展望するかについて、さまざまな意見を聞くことができ、理解が深まりました。

公開情報から一步踏み込んだ講演をいただき、理解を深めることができ、大きな収穫でした。

自身の業務と直接関係がない分野であっても、多くの企業が協力してナノインプリントのエコシステムを構築しようとしている姿に感動しました。



今後の講習会情報

次回開催：2026年2月20日（金）

テーマ：水資源をめぐる最新技術とその展望

最新情報は[グリーン・DXプラズマコンソーシアム（CGDP）](#)のホームページでチェックしてください

交流会の様子